

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2007年10月25日 (25.10.2007)

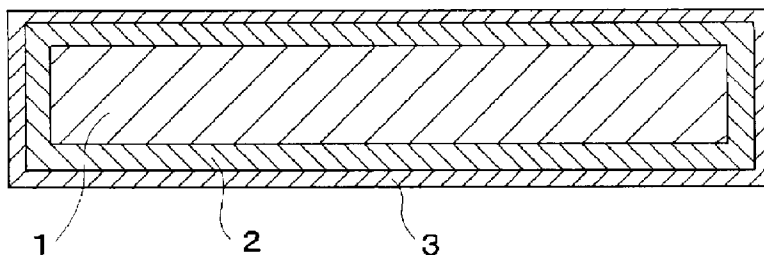
PCT

(10) 国際公開番号
WO 2007/119382 A1

- (51) 国際特許分類:
H01H 1/06 (2006.01) C25D 7/00 (2006.01)
C22C 5/04 (2006.01) H01H 1/04 (2006.01)
C23C 30/00 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2007/055285
- (22) 国際出願日: 2007年3月15日 (15.03.2007)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願2006-075231 2006年3月17日 (17.03.2006) JP
特願2007-065855 2007年3月14日 (14.03.2007) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 古河電気工業株式会社 (THE FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1008322 東京都千代田区丸の内2丁目2番3号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 小林良聡 (KOBAYASHI, Yoshiaki) [JP/JP]; 〒1008322 東京都千代田区丸の内2丁目2番3号 古河電気工業株式会社内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 飯田敏三 (IIDA, Toshizo); 〒1050004 東京都港区新橋3丁目1番10号 石井ビル3階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告書
- 2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: ELECTRIC CONTACT MATERIAL AND METHOD FOR MANUFACTURING SAME

(54) 発明の名称: 電気接点材料及びその製造方法



(57) Abstract: In an electric contact material, a conductive base body is provided with a first layer composed of a noble metal having an arithmetic average roughness $Ra=(A)\mu m$ or an alloy having a noble metal as a main component; and a second layer, which is arranged on an upper layer of the first layer and is composed of a noble metal having a film thickness of $0.001\times(A)\mu m$ or more but not more than $(A)\mu m$ or an alloy having a noble

metal as a main component. The noble metal forming the second layer or the noble metal which is the main component of the alloy forming the second layer is an element different from that of the noble metal forming the first layer or the noble metal which is the main component of the alloy forming the first layer.

(57) 要約: 導電性基体上に、算術平均粗さ $Ra=(A)\mu m$ である貴金属または貴金属を主成分とした合金からなる第1層と、該第1層の上層に皮膜厚さが $0.001\times(A)\mu m$ 以上 $(A)\mu m$ 以下の貴金属または貴金属を主成分とした合金からなる第2層とが設けられた電気接点材料であって、前記第1層を形成する貴金属または前記第1層を形成する合金の主成分である貴金属に対して、前記第2層を形成する貴金属または前記第2層を形成する合金の主成分である貴金属が異なる元素である電気接点材料。